

多利，你好！ “克隆”技术的背景、现状与未来

作者：韩王荣，龚静编著

出版社：上海：上海人民出版社

出版日期：1998.04

总页数：119

说明：登录教客网(<https://www.jiaokey.com/book/detail/12404253.html>)查找全本阅读方式

多利，你好！ “克隆”技术的背景、现状与未来评论地址<https://www.jiaokey.com/book/de>

教客网提供千万本图书阅读地址。